

한국반도체디스플레이기술학회 2024년 국내학술대회

KCSDT 2024 GUMI

Korea Conference of Semiconductor Display Technology

2024년 5월 22일(수) ~ 24일(금) 구미, 구미코

2024년 5월 24일(금), 10:20-11:50

Room A 대회의실, 3층

소자·공정 분과

[FA1] 소자·공정 Fabrication & Nano devices

좌장: 조현빈 박사(한국전자기술연구원)

FA1-1 10:20-10:35	<p>Metal-insulator-metal Capacitor 소자의 HfO_2 Insulator 원자층 증착 공정을 위한 Hybrid Reactant</p> <p>Hybrid Reactant of HfO_2 Atomic Layer Deposition Process for Metal-insulator-metal Capacitor Applications</p> <p>이인규, 박우영, 나경필 WONIK IPS 반도체연구소</p>
FA1-2 10:35-10:50	<p>포스폰산 억제제의 기상 도포 및 선택적 제거를 통한 고유전율 박막의 영역 선택적 원자층 증착법</p> <p>Enhanced Deposition Selectivity of High-k Dielectrics by Vapor Dosing and Selective Removal of Phosphonic Acid Inhibitors</p> <p>Jeong-Min Lee, Seo-Hyun Lee, and Woo-Hee Kim Department of Materials Science and Chemical Engineering, Hanyang University</p>
FA1-3 10:50-11:05	<p>Characterization of Ceria Nanoparticles as Abrasives Applied with Defoaming Agents for Semiconductor CMP Applications</p> <p>Sohee Hwang, SooYeon Choi, and Woonjung Kim Department of Chemistry, University of Hannam</p>
FA1-4 11:05-11:20	<p>비대칭 일함수 금속을 사용한 ZrO_2 시냅스 MFMS FeTFT</p> <p>ZrO_2 Synaptic MFMS FeTFT Using Asymmetric Metal Work-function</p> <p>윤승현¹, 정철원², 구분철¹, 박경수¹, 박준혁¹, 최창환¹ ¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 에너지공학과</p>

한국반도체디스플레이기술학회 2024년 국내학술대회

KCSDT 2024 GUMI

Korea Conference of Semiconductor Display Technology

2024년 5월 22일(수) ~ 24일(금) 구미, 구미코

FA1-5 11:20-11:35	Si 비율이 비정질 In-Zn-O 박막 트랜지스터의 전기적 특성에 미치는 영향 분석 Effect of Si Ratio on Electrical Performance of Amorphous In-Zn-O Thin-Film Transistor 이선진 ^{1,3} , 이상렬 ^{2,3} ¹ 가천대학교 반도체공학전공, ² 가천대학교 차세대반도체전공, ³ 가천대학교 Gachon Advanced Institute of Semiconductor Technology
FA1-6 11:35-11:50	Top Gate a-IGZO 박막 트랜지스터의 도핑 조건이 a-IGZO 막의 전기전도도에 미치는 영향 Effect of Doping Conditions on Amorphous IGZO Electrical Conductivity 최승준, 문승재, 배병성 호서대학교 반도체공학과
